

Is Ge substituting for Si?

–ゲルマニウムはシリコンを代替するの
か?–

更なるデバイス性能向上のために、いよいよ
微細化以外の手法の導入に迫られておりま
す。Ge は Si の代替チャネル材料として期待
されておりますが、Ge 特有の問題も露呈して
きました。

Ge は Si を代替するのか、本シンポジウムで
は、第一線の研究者からの報告を基に議論
致し、今後のデバイス開発のヒントを探ります。

皆様のご参加をお待ちしております。

Invited Speakers

Akira Toriumi (Univ. Tokyo)
Shinichi Takagi (Univ. Tokyo)
Yao-Jen Lee (NDL, Taiwan)
Yung-Hsien Wu (NTHU, Taiwan)
Wen Hsin Chang (AIST)
Seiji Samukawa (Tohoku Univ.)
Kohei Hamaya (Osaka Univ.)

**JSAP
Symposium**

**Date:
March 19
2018**

**Venue:
Waseda
Univ.**

**Official
Language:
English
(英語セッション)**

Organizers

K. Endo
(AIST)
T. Shinada
(Tohoku Univ.)
T. Irisawa
(AIST)